ромбоэдрический субоксид  $Nb_xO$  (x<6), композитное соединение «NbO»·n«MeF» (Me=K, Rb, n=1, 2). [3].

Для танталсодержащих расплавов, наиболее характерными катодными продуктами являются оксидные бронзы с кубической, тетрагональной и гексагональной решеткой:  $K_{1-x}TaO_3$ ,  $K_{6-x}Ta_{10.8}O_{30}$  и  $K_6Ta_{6.5}O_{15+x}F_{6+y}$ , соответственно [3]. В то же время цезий при электросинтезе образует соединения с общей формулой  $Cs^{n+}_{2+z}O_{5+y}F_{1-y}$ . со структурой пирохлора.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. Kuznetsov Sergey A. Electrochemistry of refractory metals in molten salts: Application for the creation of new and functional materials // Pure and Applied Chemistry. 2009. Vol. 81. No. 8. P. 1423-1439.
- 2. Kuznetsov S.A. Electrochemical synthesis of nanomaterials in molten salts I. Synthesis of tantalum monoxide nanoneedles // J. Electrochem. Soc. 2017. V. 164. P. H5145–H5149.
- 3. Kuznetsov S.A. Electrochemical synthesis of novel niobium and tantalum compounds in molten salts // Molten Salts Chemistry: from Lab to Applications. Boston: Elsevier Inc. 2013. P. 311–329.

М.А. Плетнев, проф., д-р хим. наук ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, Ижевск

## **КООПЕРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В АНОДНОМ РАСТВОРЕНИИ ЖЕЛЕЗА**

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных анодному растворению (AP) железа, нет оснований полагать, что имеющиеся в литературе экспериментальные факты получили исчерпывающую теоретическую трактовку.

Принятый в литературе способ интерпретации данных по анодному растворению железа после первых работ А.Н. Фрумкина и сотр. [1] заключается в составлении схемы, предусматривающей адсорбцию нуклеофильных частиц N (воды, анионов фона, молекул или ионов ингибиторов) и их участие в стадиях последовательного отрыва одного электрона в каждой электрохимической стадии.

$$Fe + N \rightarrow FeN^+ + e,$$
 (1)

$$FeN^+ \to Fe^{2+} + N + e. \tag{2}$$

Кинетическое уравнение, с учетом того, что стадии (1) и (2) относятся к атомам металлов на «активных центрах» поверхности и

подчиняются закономерностям теории замедленного разряда, записывалось в виде:

$$i_a = k_a[N] \exp\left[\frac{(n\alpha + 1)F}{RT}E_a\right],\tag{3}$$

где n и  $k_a$  — константы; [N] — концентрация нуклеофильного компонента — участника анодной реакции;  $\alpha$ - коэффициент переноса (как правило,  $\alpha$ =0,5);  $E_a$  — потенциал электрода относительно электрода сравнения.

В работах Я.М. Колотыркина [2] и ряда других авторов было предложено рассматривать механизм анодного процесса как суперпозицию частных путей с участием всех нуклеофильных компонентов электролита. Так, для кислых сульфатных сред была предложена [36] схема процесса, согласно которой в нем принимают участие молекулы воды и анионы  $SO_4^{2-}$  и  $HSO_4^{-}$ .

В работах Чина и Ноуба [3] для интерпретации данных по анодному растворению железа в кислых хлоридных средах (рис.3) был предложен механизм, который предусматривает участие в анодном процессе воды И хлорид-ионов. Для объяснения наблюдаемых при концентрации анионов свыше отрицательных значений порядка анодного процесса по гидроксидионам тон была предложена гипотеза об участии в анодном процессе в сильнокислых (рН<0) растворах протонов (ионов гидроксония).

Поскольку протоны не являются нуклеофильными частицами, то их участие в предложенной кинетической схеме достаточно спорно, тем более что в перхлоратных растворах в той же области pH такое поведение  $lgi_a$  - pH- зависимости не воспроизводилось.

Расширение рабочих интервалов рН и потенциалов, а также обнаружение в ряде случаев очевидных отклонений  $\lg i_a$  -  $\eta_a$  зависимости от тафелевой привело к усложнению моделей, принимаемых в качестве основы при описании экспериментальных данных. Бек-Нильсен и практически одновременно Лоренцем были разработаны кинетические схемы, основанные на предположении о параллельном протекании нескольких скоростьопределяющих стадий. Однако все предложенные модели являлись лишь усложнением последовательной схемы Фрумкина.

С учетом того, что от металлической матрицы наиболее легко отрываются ионы, находящиеся на поверхности металла в полукристаллических положениях (кинках), а время жизни иона в кинке существенно меньше времени адсорбции нуклеофильной частицы (молекулы воды или аниона), Г.В. Халдеевым [4],

Р.М. Лазоренко-Маневичем было допущено, что эти частицы не принимают участия в элементарных стадиях анодного процесса.

Развитый в ряде работ наш подход к интерпретации данных по анодному растворению железа основан на анализе следующих данных.

1. Делокализация протона в гидратных комплексах приводит к укорочению водородных связей. В результате в растворах кислот происходит упрочение водородных связей по сравнению с растворами солевых 1-1 электролитов. Состояние протонов в воде можно уподобить электронам в полупроводниках. Протоны так координируют воду, что, например, в растворах HNO<sub>3</sub> в интервале 0,05 – 0,40 мольных доли колебания связей О – H, характерные для молекул воды, вообще отсутствуют.

При концентрации HCl (HBr) > 1 моль/л протонирование гидратных комплексов приводит к тому, что на границе раздела воздух — раствор часть молекул воды переориентируется атомами кислорода вглубь жидкой фазы, в результате чего галид-ионы выталкиваются на поверхность раздела, заряжая ее отрицательно. Резкий рост коэффициента активности протонов с увеличением концентрации HCl и HBr выше 1 моль/л свидетельствует о преимущественно кооперативном характере переноса протонов в кислых растворах, что подтверждается данными по числам переноса в кислых хлоридных растворах в интервале 1 — 4 моль/л.

Таким образом, определяющим свойством водных растворов кислот является кооперативный характер водородных связей, объясняющий совокупность физико-химических свойств этих систем.

2. Металлическая структура характеризуется одновременным присутствием в металле положительно заряженных ионов и некоторого количества свободных электронов. Рентгенографические исследования подтверждают наличие непрерывного распределения постоянной электронной плотности в решетке металла и ионизацию атомных остовов. В частности, для атомов железа число электронов на атомном остове в кристаллической решетке металла составляет 23, т.е. каждый атом железа имеет заряд +3.

По этой причине активационный барьер, связанный с переносом первого по схеме (1) и второго по схеме (2) электронов с атома в зону проводимости металла, отсутствует. При этом поверхностный ион  $Me^{\delta^+}$  остается, по существу, внутри «электронной атмосферы» металла.

Характерной особенностью низкоиндексных граней кристаллов является фасетирование поверхности — образование одно- или

многоатомных ступеней, разделяющих плоские участки плотноупакованных граней. С учетом изложенного, поверхность монокристаллического электрода содержит ряд структурных дефектов разного уровня: вакансии; междоузельные атомы; дислокации; ступени; изломы на одноатомных ступенях — кинки и плоские участки грани - террасы.

Адсорбированные частицы, себе замыкая на некомпенсированные валентные орбитали поверхностных атомов, влияют на плотность поверхностных электронных состояний. Адсорбция нуклеофильных частиц и их десорбция в сверхвысоком вакууме, изменение потенциала электрода индуцируют поверхностные напряжения, результатом которых могут стать релаксация, реконструкция фасетирование поверхности И образованием вицинальных граней с периодической морфологией. Наблюдаемые явления являются двумерными фазовыми переходами второго рода и обусловлены кооперативным характером электронной подсистемы металлов.

Таким образом, при анализе анодного растворения в системе металл — раствор кислоты необходимо учитывать кооперативную природу электронной подсистемы металла и протонной подсистемы кислого электролита.

Нами был анализ закономерностей анодного растворения железа на основе представлений о дискретном строении поверхности металла и кооперативном характере процесса растворения [5].Поверхность растворяющегося электрода была представлена как поверхность монокристалла, которая содержит дислокации, ступени, изломы на одноатомных ступенях — кинки и плоские участки грани-террасы. Анодная поляризация проявляется в уменьшении плотности электронных состояний металла как кооперативной системы. В области низких анодных перенапряжений растворение идет последовательно из полукристаллических положений на поверхности металла — кинков.

Допущено, что скоростьопределяющим процессом при анодной ионизации металла в области низких перенапряжений является десорбция двухзарядного иона с поверхности, требующая "встраивания" его в приэлектродный слой электролита. С учетом этого предложен следующий маршрут реакции анодного растворения гидрофильного металла в области низких перенапряжений:

$$[(Me_v Me_v)]^{n+} \leftrightarrow [(Me_v) Me_k]^{n+}$$
 (I)

$$[(Me_v)Me_k]^{n+} \leftrightarrow [(Me_v)(Me_k Me_s)]^{n+}$$
(II)

$$[(Me_v) (Me_k Me_s)]^{n+} \rightarrow [(Me_v) (Me_k)]^{(n-m)+} + [Me (H_2O)_x N_v]^{m+} (III)$$

Предшествующая стадия (I)представляет частичное разрушение кристаллической решетки анодно поляризованного (с условным зарядом n<sup>+</sup>) металла с образованием полукристаллического состояния Мек. Следующей стадией является выход атома металла из кинка переход В адсорбированное состояние  $Me_s$ Скоростьопределяющей стадией (актом деполяризации анода как кооперативной системы с принудительно заниженным поляризацией уровнем Ферми) является вхождение иона металла в поверхностный слой электролита (взаимодействие водой c нуклеофильными компонентами электролита N) (III). Перенапряжение этого процесса может быть отождествлено с перенапряжением стадии разряда-ионизации.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. Kabanov B., Burstein R., Frumkin A. // Disc. Faraday Soc. 1947. V.1. P.259.
- 2. Флорианович Г.М., Соколова Л.А., Колотыркин Я.М. // Электрохимия. 1967. Т. 3. №11. С. 1359.
- 3. Chin R.J., Nobe K. // J. Electrochem. Soc. 1972. V. 119. № 11. P. 1457.
- Халдеев Г. В., Камелин В. В // Успехи химии. 1992. Т. 61. №9. С. 1623.
- 4. Решетников С.М., Плетнев М.А. Защита металлов.- 2004. Т. 40. №5. С. 513.

УДК 621.357.7 +621.793.3

Л.С. Цыбульская, канд. хим. наук, С.С. Перевозников, научн. сотр. НИИ физико-химических проблем БГУ, Минск

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ И СВЕТОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Среди промышленных процессов осаждения металлов из водных растворов химическое и электрохимическое никелирование являются широко используемыми. Никелевые покрытия востребованы в приборо-, машино-, тракторо-, авиа- и ракетостроении, в производстве оптико-электронной аппаратуры, в изделиях микроэлектроники, что обусловлено их высокой коррозионной стойкостью, твердостью, износостойкостью и электропроводностью. Тем не менее, для улучшения физико-механических и защитно-коррозионных свойств в никелевые покрытия вводят неметаллы (бор, фосфор, углеродные